

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大見俊一郎 副委員長 宇佐美達矢

幹事 諏訪智之・野田泰史 幹事補佐 細井卓治・二瀬卓也

日時 10月19日(水) 9:40~17:05

会場 オンライン開催

議題 プロセス科学と新プロセス技術

午前 (9:40~11:45)

1. [チュートリアル] 半導体製造における有機物汚染 諏訪智之(東北大)
2. [招待講演] エックス線光学素子のニーズ—新プロセス技術への期待— 矢代 航(東北大)
3. 次世代メモリ用薄膜の統計的解析を行う高精度・広範囲抵抗測定技術
○光田薫未・天満亮介・間脇武蔵・黒田理人(東北大)

午後 (13:00~17:05)

4. [招待講演] 表面熱析出法を用いた単原子層 h-BN 薄膜/LaB₆ ヘテロ構造の作製とその評価
○長岡克己(物質・材料研究機構)・大見俊一郎(東工大)
5. 強誘電体 BiFeO₃ 薄膜表面の評価と分析 今泉文伸(小山高専)
6. CrSiC 薄膜抵抗体の微細構造が電気特性に与える影響
○伊藤 望・前川和義・高橋裕治・利根川 丘(ルネサスエレクトロニクス)
7. [招待講演] 紙の基板を用いた有機強誘電体トランジスタの作製と有機太陽電池への応用
朴 炳垠(ソウル市大)
8. A study on low-voltage operation of pentacene-based floating-gate memory utilizing Ar/N₂-plasma nitridation with N-doped LaB₆ metal and high-k LaB_xN_y insulator ○Eun-Ki Hong・Shun-ichiro Ohmi(Tokyo Inst. of Tech.)
9. [招待講演] CO₂ 熱処理による SiC MOSFET の信頼性向上
○細井卓治(関西学院大)・志村考功・渡部平司(阪大)

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11月10日(木), 11日(金) オンライン開催 [締切済] テーマ: プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

【問合せ先】

SDM 幹事: 諏訪智之(東北大)

TEL [022] 795-3977

E-mail: tomoyuki.suwa.b6@tohoku.ac.jp